

# 片状氧化铝微粉平替FUJIMI PWA15抛光粉用于砷化镓晶圆CMP处理

产品名称	片状氧化铝微粉平替FUJIMI PWA15抛光粉用于砷化镓晶圆CMP处理
公司名称	郑州市海旭磨料有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:海旭磨料 型号:HXTA15 产地:河南
公司地址	中国河南省郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际城1号楼1409室
联系电话	0371-60900389 13526538098

## 产品详情

片状氧化铝微粉平替FUJIMI PWA15抛光粉用于砷化镓晶圆CMP处理

片状氧化铝又称平板状氧化铝抛光粉，它的用途是晶圆的抛光研磨表面处理。平板状氧化铝其实是一种通过特殊方法进行长晶的煅烧氧化铝。其煅烧温度问1200度，制成的氧化铝呈片状堆积形态。通过破碎和水洗工艺，将片状氧化铝粉进行分层，制成氧化铝纯度和清洁度更高，颗粒集中度窄、易分散的片状氧化铝微粉。不同的煅烧工艺对片状氧化铝的质量影响很大，质量好的平板状氧化铝晶体结构平整，磨削面无凹凸，颗粒致密度高，硬度高，易分散不会团聚，因此不会对硅片和晶圆造成损伤。片状氧化铝的晶体厚度为2-3um，颗粒直径3-50um。

片状氧化铝微粉/平板状氧化铝抛光粉的特点：

1. 海旭磨料生产的片状氧化铝对标进口产品，可以达到进口片状氧化铝粉的研磨效果。
2. 晶型平整无棱角，研磨时磨粒于工件之间产生平面滑动效果，不易产生划痕。
3. 硬度高，磨削力强。片状氧化铝具有类似于刚玉的 -

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>晶相，适用与大多数材料的研磨和抛光。

4. 磁性物含量低，清洁度高，粒径一致性高。
5. 熔点高，机械强度高，磨削效率高。
6. 颗粒大小可控，3-50微米均可获得。
7. 颗粒的平整性使片状氧化铝粉体易于分散，适合制成研磨剂或研磨液。
8. 耐腐蚀、化学稳定性强、抗氧化性能优越，不会于研磨液中的液体介质发生反应。
9. 比表面积大，表面活性和附着力由于电熔刚玉。
10. 片状氧化铝易于分散，粉体不易团聚在晶圆表面造成堆积，影响抛光平整度。

化学成分：

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
SiO <sub>2</sub>	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
Na <sub>2</sub> O	

物理性能：

化学成分	
颜色	
比重	
莫氏硬度	

生产规格：

型号	D3(um)	
HXTA40	39-44.6	
HXTA35	35.4-39.8	
HXTA30	28.1-32.3	
HXTA25	24.4-28.2	
HXTA20	20.9-24.1	

HXTA15	14.8-17.2	
HXTA12	11.8-13.8	
HXTA09	8.9-10.5	
HXTA05	6.6-7.8	
HXTA03	4.8-5.6	

用途：

1. 半导体硅晶片、石英晶体、砷化镓晶体研磨液
2. 光学玻璃、光电陶瓷研磨
3. 导热涂料填充
4. 精密油石原材料
5. 抛光砂带砂纸原料
6. 软质金属研磨抛光
7. 耐热耐磨涂层